

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成17年12月22日(2005.12.22)

【公表番号】特表2004-531879(P2004-531879A)

【公表日】平成16年10月14日(2004.10.14)

【年通号数】公開・登録公報2004-040

【出願番号】特願2002-570011(P2002-570011)

【国際特許分類第7版】

H 01 L 21/027

B 05 D 1/40

B 05 D 3/04

G 03 F 7/16

【F I】

H 01 L 21/30 5 6 4 D

B 05 D 1/40 A

B 05 D 3/04 Z

G 03 F 7/16 5 0 2

【手続補正書】

【提出日】平成17年2月15日(2005.2.15)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板の表面にコーティングする方法であつて、

密閉ハウジング内に基板を装着し、

前記基板上に溶剤を含む溶液を付着させ、

前記ハウジングの雰囲気内に導入される溶剤の量を調整することにより、前記溶液からの溶剤の蒸発を制御し、

前記ハウジングの雰囲気内に導入される溶剤の量を調整することは、溶剤蒸気分圧が異なる複数のガスを混合して制御ガスを形成することにより、前記ハウジングの雰囲気内に導入される前記制御ガスの飽和の度合いを0%~約40%の範囲内で調整することを含む、方法。

【請求項2】

前記基板を回転させることを含む、請求項1に記載の方法。

【請求項3】

前記基板が可変速度で回転される、請求項2に記載の方法。

【請求項4】

前記基板が、約2000rpm未満の回転速度で回転される、請求項2に記載の方法。

【請求項5】

前記基板が、当該基板上に4.0オングストローム(0.4nm)以下の1シグマ膜均一性を可能とする十分な時間だけ回転する、請求項2に記載の方法。